(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-342931 (P2000-342931A)

(43)公開日 平成12年12月12日(2000,12.12)

(51) Int.Cl.7

識別記号

ZAB

FΙ

テーマコード(参考)

B01D 53/70

53/34

134E 4D002

B01D 53/34

ZAB

審査請求 未請求 請求項の数9 OL (全 11 頁)

(21)出願番号

特願平11-162335

(22)出願日

平成11年6月9日(1999.6.9)

(31)優先権主張番号 特願平10-170899

(32)優先日

平成10年6月18日(1998.6.18)

(33)優先権主張国

日本(JP)

(31)優先権主張番号 特願平11-87041

(32)優先日

平成11年3月29日(1999.3.29)

(33)優先権主張国

日本 (JP)

(71)出願人 592010106

カンケンテクノ株式会社

大阪府吹田市垂水町3丁目18番9号

(72)発明者 今村 啓志

大阪府吹田市垂水町3丁目18番9号 カン

ケンテクノ株式会社内

(74)代理人 100082429

弁理士 森 義明

Fターム(参考) 4D002 AA22 AC10 BA02 BA03 BA04

BA05 BA12 CA01 CA07 DA05 DA07 DA11 DA16 DA35 DA56 EA02 GA01 GA02 GB01 GB02 GB03 GB06 GB08 GB11 GB20

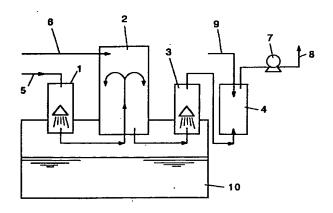
HA03

(54) 【発明の名称】 パーフルオロカーボンガスの除去方法及び除去装置

(57)【要約】

【課題】 できる限り低温で(消費熱エネルギー低く) PFC成分を高い除去率で分解除去することが可能な除 去方法及び除去装置を提供する。

【解決手段】 被処理ガスを水洗し、次いで低級飽和炭 化水素ガス又は低級不飽和炭化水素ガス又はNH3ガス の何れか1種またはこれら2種以上の混合ガスを水洗後 の被処理ガスに混合して遊離O2の無い状態下で加熱分 解し、次いで加熱分解により発生したフッ素化合物を水 洗除去し、次いで外部空気存在下で燃焼して可燃性成分 を燃焼除去させる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 被処理ガスを水洗し、

次いで低級飽和炭化水素ガス又は低級不飽和炭化水素ガス又はNH3ガスの何れか1種またはこれら2種以上の混合ガスを水洗後の被処理ガスに混合して遊離O2の無い状態下で加熱分解し、

次いで加熱分解により発生したフッ素化合物を水洗除去し、

次いで外部空気存在下で燃焼して可燃性成分を燃焼除去 させることを特徴とするパーフルオロカーボンガスの除 去方法。

【請求項2】 被処理ガスを水洗し、

次いで低級飽和炭化水素ガス又は低級不飽和炭化水素ガス又はNH3ガスの何れか1種またはこれら2種以上の混合ガスを水洗後の被処理ガスに混合して遊離O2の無い状態下で加熱分解し、

次いで加熱分解後のガスを外部空気存在下で燃焼して可 燃性成分を燃焼除去させ、

次いで加熱分解により生じたフッ素化合物を水洗除去することを特徴とするパーフルオロカーボンガスの除去方法。

【請求項3】 被処理ガスを水洗し、

次いで低級飽和炭化水素ガス又は低級不飽和炭化水素ガス又はNH3ガスの何れか1種またはこれら2種以上の混合ガスを水洗後の被処理ガスに混合して遊離O2の無い状態下で加熱分解し、

次いで加熱分解により発生したフッ素化合物をCaO又はCaCO3粒状体に化学吸着させて除去し、

次いで外部空気存在下で燃焼して可燃性成分を燃焼除去 させることを特徴とするパーフルオロカーボンガスの除 去方法。

【請求項4】 加熱分解に際して水洗後の被処理ガスと混合するガスはCH4、C2H6、C3H8、C4H10又はNH3ガスのいずれか、又はこれら2種以上の混合ガスであることを特徴とする請求項1,請求項2又は請求項3記載のパーフルオロカーボンガスの除去方法。

【請求項5】 被処理ガスを水洗するための第1の水スクラバと、第1の水スクラバの下流側に設けられたガス分解塔と、該ガス分解塔の下流側に設けられた第2の水スクラバと、該第2の水スクラバの下流側に設けられ処理済みガスを外部空気存在下で燃焼させるための燃焼塔を備えており、

前記ガス分解塔は、低級飽和炭化水素ガス又は低級不飽和炭化水素ガス又はNH3ガスの何れか1種またはこれら2種以上の混合ガスと混合された被処理ガスを遊離O2の無い状態下で加熱分解することが可能であることを特徴とするパーフルオロカーボンの除去装置。

【請求項6】 被処理ガスを水洗するための第1の水ス クラバと、第1の水スクラバの下流側に設けられたガス 分解塔と、該ガス分解塔の下流側に設けられ処理済みガ スを外部空気存在下で燃焼させるための燃焼塔と、該燃 焼塔の下流側に設けられた第2の水スクラバを備えてお り、

前記ガス分解塔は、低級飽和炭化水素ガス又は低級不飽和炭化水素ガス又はNH3ガスの何れか1種またはこれら2種以上の混合ガスと混合された被処理ガスを遊離O2の無い状態下で加熱分解することが可能であることを特徴とするパーフルオロカーボンの除去装置。

【請求項7】 被処理ガスを水洗するための第1の水スクラパと、第1の水スクラパの下流側に設けられたガス分解塔と、該ガス分解塔の下流側に設けられCaO又はCaCO3粒状体が充填された吸着塔と、処理済みガスを外部空気存在下で燃焼させるために該吸着塔の下流側に設けられた燃焼塔を備えており、

前記ガス分解塔は、低級飽和炭化水素ガス又は低級不飽和炭化水素ガス又はNH3ガスの何れか1種またはこれら2種以上の混合ガスと混合された被処理ガスを遊離O2の無い状態下で加熱分解することが可能であることを特徴とするパーフルオロカーボンの除去装置。

【請求項8】 ガス分解塔と燃焼塔とが耐熱性を有する 隔壁を介して一体に形成されてなるガス分解燃焼塔を備 えたことを特徴とする請求項6記載のパーフルオロカーボンの除去装置。

【請求項9】 被処理ガスを水洗するための第1の水スクラバと、第1の水スクラバの下流側に設けられたガス分解燃焼塔と、該ガス分解燃焼塔の下流側に設けられた第2の水スクラバを備えており、

ガス分解燃焼塔は第1の水スクラバ及び第2の水スクラ バの上方に配されており、

ガス分解燃焼塔はガス分解塔と、該ガス分解塔の下流側 に位置し耐熱性を有する隔壁により該ガス分解塔と上端 部が連通した状態で区画された燃焼塔を有し、

ガス分解燃焼塔には前記隔壁を貫通するように水平方向 に複数本の電気ヒータが設置されており、該電気ヒータ の下方には熱遮蔽効果を有する耐熱棒が水平方向に複数 本設置されており、

前記ガス分解塔は、低級飽和炭化水索ガス又は低級不飽和炭化水索ガス又はNH3ガスの何れか1種またはこれら2種以上の混合ガスと混合された被処理ガスを遊離O2の無い状態下で加熱分解することが可能であり、

前記燃焼塔はガス分解塔で加熱分解処理されたガスを外部空気存在下で燃焼させることができることを特徴とするパーフルオロカーボンの除去装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、半導体、液晶等の 電子回路素子の製造中、特にクリーニング、エッチング 工程において派生する排ガスの除去方法及び除去装置に 関するものであって、更にはアルミニウム精錬時に発生 するガスの除去にも適応可能なものに関する。

[0002]

【従来の技術】以下、本発明分野を電子回路素子製造におけるクリーニング、エッチング工程に使用されるガスの除去に限定して説明するが、アルミニウム精錬において発生するガスの除去にも適用可能である。

【0003】ここで使用されるガスの一群にPFCがある。これはパーフルオロカーボン(Perfluorocarbon)の略称であり、CF4、CHF3、C2F6がその代表的化合物である。Carbonの代わりにCompoundを使用した場合には更に、NF3、SF6、SF4のようなCを含まないフッ素化合物が対象として加わってくる。

【0004】本発明は今日でも除去装置、除去方法として技術的に使用できる域に達していない前者PFCの除去を対象として技術確立を図ったものであるが、勿論後者を含む全てのPFCに適用することができる技術である。

【0005】CF4. C2F6を代表とするPFCは不燃性であり、又ガス自体の人体への毒性は不明であり、少なくとも急性、亜急性の毒性は知られていない。しかしながら、化合物そのものが安定であるため、大気中に放出された場合、長期わたって変化せず滞留することになる。大気中における消費までのライフはCF4で50,000年、C2F6で10,000年といわれており、又、地球温暖化係数(CO2を1としての比較値)はCF4で4,400、C2F6で6,200(20年経過時点)であり、地球環境上放置できない問題をはらんでいる。したがって、CF4. C2F6を代表とするPFCを除去する手段の確立が望まれている。

【0006】しかしながら、前者PFC、すなわちCF4、CHF3、C2F6を代表とした化合物はC-F結合が安定であるため(結合エネルギーが120kcal/molと大きく)、分解が容易でなく、単純な加熱酸化分解での除去は極めて難しい。

【0007】例えばC2F6の場合はC-C結合枝の切断で分解が進むため、処理温度1000℃において処理風量を250リットル/min以下に制限して除去が可能であるが、CF4は最も結合エネルギーの大きなC-Fを切断せねばならず、上記風量においても1400℃を必要とし、それでも80%以上の除去を行うのは困難である。

【 O O O 8 】又、1400℃以上の高温雰囲気の達成は、電 熱ヒータの場合、発熱体材料からも限界であり、長時間 の使用は不可能に近い。そして、装置全体の保温も困難 であり、断熱材の組み合わせにおいても全体の容積が大 きくなってコンパクトな装置とはならない。更に重要な 点は熱エネルギーコストが過大となることである。

【0009】尚、この分野において次の新しい提案が示されている。International Publication Number W094/05399 #Method of Decomposing Gaseous Halocarbon#には、例えばCF4の除去においてO2を併存させると分解温度が600~700℃で可能であるとの報告があるが、その

記載内容を詳細に追試しても、この条件では全く除去することができなかった。

【0010】更にまた、H2ガスを積極的に導入し、PFCを加熱分解する試みも有るが、処理温度を高温とする必要があり、更にはH2ガスは可燃性、爆発性のガスであるため、安全性の点から使用するには躊躇される。

【発明が解決しようとする課題】そこで、できる限り低温で(消費熱エネルギー低く)PFC成分を高い除去率で分解除去することが可能な除去方法及び除去装置が求められている。

[0012]

【課題を解決するための手段】本発明の除去方法及び除去装置は、低温でPFC成分を除去し、派生したF成分は別個洗浄又は固定化排除し、その他の成分は基本的にCO2. H2Oとして大気放出する装置及び方法を提案するものである。具体的には、請求項1記載のパーフルオロカーボンガスの除去方法は、被処理ガスを水洗し、次いで低級飽和炭化水素ガス又は低級不飽和炭化水素ガス又はNH3ガスの何れか1種またはこれら2種以上の混合ガスを水洗後の被処理ガスに混合して遊離O2の無い状態下で加熱分解し、次いで加熱分解により発生したフッ素化合物を水洗除去し、次いで外部空気存在下で燃焼して可燃性成分を燃焼除去させることを特徴とする。

【0013】請求項2記載のパーフルオロカーボンガスの除去方法は、被処理ガスを水洗し、次いで低級飽和炭化水素ガス又は低級不飽和炭化水素ガス又はNH3ガスの何れか1種またはこれら2種以上の混合ガスを水洗後の被処理ガスに混合して遊離O2の無い状態下で加熱分解し、次いで加熱分解後のガスを外部空気存在下で燃焼して可燃性成分を燃焼除去させ、次いで加熱分解により生じたフッ素化合物を水洗除去することを特徴とする。

【〇〇14】請求項3記載のパーフルオロカーボンガスの除去方法は、被処理ガスを水洗し、次いで低級飽和炭化水素ガス又は低級不飽和炭化水素ガス又はNH3ガスの何れか1種またはこれら2種以上の混合ガスを水洗後の被処理ガスに混合して遊離〇2の無い状態下で加熱分解し、次いで加熱分解により発生したフッ素化合物をCaO又はCaCO3粒状体に化学吸着させて除去し、次いで外部空気存在下で燃焼して可燃性成分を燃焼除去させることを特徴とする。

【0015】請求項4記載のパーフルオロカーボンガスの除去方法は、請求項1.請求項2又は請求項3記載の除去方法において、加熱分解に際して水洗後の被処理ガスと混合するガスはCH4、C2H6、C3H8、C4H10又はNH3ガスのいずれか、又はこれら2種以上の混合ガスであることを特徴とする。

【0016】請求項5記載のパーフルオロカーボンの除去装置は、被処理ガスを水洗するための第1の水スクラバ(1)と、第1の水スクラバ(1)の下流側に設けられたガ

ス分解塔(2)と、該ガス分解塔(2)の下流側に設けられた第2の水スクラバ(3)と、該第2の水スクラバ(3)の下流側に設けられ処理済みガスを外部空気存在下で燃焼させるための燃焼塔(4)を備えており、前記ガス分解塔(2)は、低級飽和炭化水素ガス又は低級不飽和炭化水素ガス又はNH3ガスの何れか1種またはこれら2種以上の混合ガスと混合された被処理ガスを遊離O2の無い状態下で加熱分解することが可能であることを特徴とする。

【0017】請求項6記載のパーフルオロカーボンの除去装置は、被処理ガスを水洗するための第1の水スクラバと、第1の水スクラバの下流側に設けられたガス分解塔と、該ガス分解塔の下流側に設けられ処理済みガスを外部空気存在下で燃焼させるための燃焼塔と、該燃焼塔の下流側に設けられた第2の水スクラバを備えており、前記ガス分解塔は、低級飽和炭化水素ガス又は低級不飽和炭化水素ガス又はNH3ガスの何れか1種またはこれら2種以上の混合ガスと混合された被処理ガスを遊離02の無い状態下で加熱分解することが可能であることを特徴とする。

【0018】請求項7記載のパーフルオロカーボンの除去装置は、被処理ガスを水洗するための第1の水スクラバと、第1の水スクラバの下流側に設けられたガス分解塔と、該ガス分解塔の下流側に設けられてaO又はCaCO3粒状体が充填された吸着塔と、処理済みガスを外部空気存在下で燃焼させるために該吸着塔の下流側に設けられた燃焼塔を備えており、前記ガス分解塔は、低級飽和炭化水素ガス又は低級不飽和炭化水素ガス又はNH3ガスの何れか1種またはこれら2種以上の混合ガスと混合された被処理ガスを遊離O2の無い状態下で加熱分解することが可能であることを特徴とする。

【0019】請求項8記載のパーフルオロカーボンの除去装置は、請求項6の除去装置において、ガス分解塔(12)と燃焼塔(14)とが耐熱性を有する隔壁(13)を介して一体に形成されてなるガス分解燃焼塔(11)を備えたことを特徴とする。

【〇〇2〇】請求項9記載のパーフルオロカーボンの除去装置は、被処理ガスを水洗するための第1の水スクラバ(31)と、第1の水スクラバ(31)の下流側に設けられたガス分解燃焼塔(21)と、該ガス分解燃焼塔(21)の下流側に設けられた第2の水スクラバ(32)を備えており、ガス分解燃焼塔(21)は第1の水スクラバ(31)及び第2の水スクラバ(32)の上方に配されており、ガス分解燃焼塔(21)はガス分解塔(22)と、該ガス分解塔(22)の下流側に位置し耐熱性を有する隔壁(23)により該ガス分解塔(22)と上端部が連通した状態で区画された燃焼塔(24)を有し、ガス分解燃焼塔には前記隔壁を貫通するように水平方向に複数本の電気ヒータ(26)が設置されており、該電気ヒータ(26)の下方には熱遮蔽効果を有する耐熱棒(29)が水平方向に複数本設置されており、前記ガス分解塔(22)は、低級飲和炭化水素ガス又は低級不飽和炭化水素ガス又は

NH3ガスの何れか1種またはこれら2種以上の混合ガスと混合された被処理ガスを遊離O2の無い状態下で加熱分解することが可能であり、前記燃焼塔(24)はガス分解塔(22)で加熱分解処理されたガスを外部空気存在下で燃焼させることができることを特徴とする。

【0021】上記の発明の主要な単位操作は次の3段階になる。

- (a) PFCの熱分解
- (b) 発生フッ素化合物の洗浄排気又は固定化除去
- (c) その他の可燃性成分の燃焼除去

本発明の最も重要なる構成は上記(a)のPFCの熱分解であり、通常の単純熱分解で必要とされる雰囲気温度を大幅に下回る温度領域で90%以上の除去率[{除去装置導入ガス中のPFC濃度-(放出ガス中のPFC濃度/除去装置導入ガス中のPFC濃度)} ×100]で処理できる技術の構築にある。

【OO22】本発明の骨子を形成するPFCの熱分解は 熱源として電気ヒータ又はLPG、LNGのような液体 燃料、CH4、H2、COのようなガス状燃料を熱源とし た火炎燃焼のいずれの手段を用いても良く、加熱に用い る熱源の位置は反応塔の外部でも内部でもよい。

【 O O 2 3 】 ガス分解塔の空間にPFCを主成分とし、通常キャリアガスとしてのN2が混合された被処理ガスを導入する。更にそこに低級の飽和又は不飽和炭化水素(ここで低級とはC1~C8成分のものを指すが、特にC1~C4成分の飽和炭化水素が好ましい)又はNH3のいずれか、又はこれらの混合ガスを同時に供給する。

【0024】その場合、例えばCVD内でO2又はO3を併用した場合、排ガスとしてその使用残ガスがガス分解塔に流入するが、それ以外は意図的にO2、O3又は外部空気を注入することはなく、少なくともガス分解塔内雰囲気を酸化状態にしないことが一つの条件となる。

【0025】かかる状況下において、被処理ガス中のPFC濃度、処理ガス風量、ガス分解塔内空間温度が所定条件とするとPFCが分解するが、この場合の雰囲気温度はPFC単独又は酸化雰囲気系での処理温度よりも数100℃低い温度においても、PFCをほぼ完全に除去できることが確認できた。

【OO26】これは、PFCの分解処理剤として導入した炭化水素やNH3が非酸化性雰囲気下で熱分解を起こし(例えば、プロパンを使用した場合、メタン、エタン、エチレン、プロレピン、水素のような多種の分解物が生成する)、その分解過程で発生するラジカル状態の活性水素がPFCの分解に寄与し、PFCのF成分がF2又はHFとして単離されるためであると考えられる。

【0027】尚、PFC単独又は酸化雰囲気系では、除去率は使用材料の限界に近い高温域を使用しても80%を越える結果を達成することは至難であり、ガス分解塔内における化合物の分解機構は本発明とは全く異なることを示している。

【0028】本発明によりガス分解塔から排出される処理後のガスは、F2又はHFと、分解処理剤の炭化水素分解ガス及び条件に応じてカーボン煤となる。そして、両成分のF系排ガスと可燃性ガスとを夫々無害に処理する。

【0029】すなわち、前者は水スクラバを通して水に吸収溶解させるか、又はCaOもしくはCaCO3の固体吸収剤で化学吸着させて分離し、系外に排気する。後者は外部空気の存在下で燃焼させ、最終処理ガスを大気放出する。

[0030]

【発明の実施の形態】以下、本発明を好適な実施例を用いて説明する。

【0031】本発明の除去装置では(a) PFCの熱分解、(b) 発生フッ素化合物の洗浄排気又は固定化除去、(c) その他の可燃性成分の燃焼除去、の3要素を実行する各種装置をキャビネットに一体に収納している。

【0032】図1は本発明の除去装置の概要を示した図である。図中、(1)はガス分解塔(2)の前段(上流側)に設けられた前部水スクラバ(第1の水スクラバ)である。PFC含有被処理ガス導入管(5)を通って送られてきたPFC含有被処理ガスは、最初にこの前部水スクラバ(1)に導かれて水洗される。

【0033】前部水スクラバ(1)から排出された被処理ガスは、水槽(10)を通ってガス分解塔(2)に送られる。ガス分解塔(2)における加熱は外部加熱方式でも内部加熱方式でも良い。いずれの場合でもガス分解塔内部(2)には腐食性を有するF2及び又はHFが発生し、金属材料ではこれらに侵されるので、インコネル(商標)の如き高Ni含有合金又は内面をAI203主体のセラミックでコーティングする必要がある。電熱ヒータを内部に設ける場合にはヒータ保護のためにAI203系セラミック保護管内に発熱体を挿填する。

【0034】N2を代表とする不活性ガスをキャリヤーとしてCF4、C2F6を代表とするPFCの使用済みガスをガス分解塔(2)に導入するが、その場合CVDにおいて使用されたO2、O3の如き酸化剤の残ガスは同時に除去装置に導入されることとなる。しかしながら、あえてO2又は空気の如き酸化剤の追加導入は行わない。

【0035】そして、積極的に還元性雰囲気形成剤として低級(C1~C8成分)の飽和又は不飽和炭化水素又はNH3、又はこれらの混合ガスを、還元性雰囲気形成剤導入管(6)を通してガス分解塔(2)に導入する。

【0036】低級の飽和又は不飽和炭化水素としては、メタン、エタン、プロパン、n-又はiso-(以下同様)ブタン、ペンタン、ヘキサン、ヘプタン、オクタン、エチレン、プロピレン、ブチレン、ブタジエン更にベンゼン、トルエン、キシレンの如き芳香族炭化水素も使用することができる。又、都市ガスも用いることができる。

【OO37】但し、炭化水素のCとHとの比率において、Cが多いほど残部のCが多くなり、煤が生じやすいので、CH4、C2H6、C3H8、C4H10等を使用することが好ましい。

【0038】又、NH3も炭化水素と同様に複数水素を結合した水素供給体としての働きを有しているので、同様に還元性雰囲気形成剤として用いることができる。更に、NH3を用いた場合には、ガス分解塔で生成したHFを中和してNH4Fの塩を形成することにより、装置材料の腐食防止に効果を奏することが期待できる。

【0039】 遠元性雰囲気形成剤としては上記の何れか 1種類のガスを単独に使用しても良いし、2種以上を混 合して用いても良い。

【0040】本発明において除去しうるPFCの濃度は 広範囲にわたっており、100ppm~5%の範囲では少なく とも90%以上除去できる。100ppm以下や5%以上の濃度 域でも除去可能であるが、90%以上の除去率を達成でき ない場合がある。

【OO41】本発明における処理ガス風量は5~700リットル/minの範囲が好ましい。5リットル/min以下でも処理は可能であるが装置のエネルギー効率が低く無駄な稼働となる。又、700リットル/min以上の場合は処理ガスに対するエネルギーの伝達が不十分となり、除去率は低下する傾向にある。

【OO42】PFCの分解にあたり共存させる還元性雰囲気形成剤のガス量はPFC1molに対し、0.1~3molが適量である。0.1mol以下の使用では本発明の目的である分解温度を下げ除去率を高める効果において不十分であり、3mol以上の場合はPFC除去率90%以上の処理ができるが、処理排ガス中に煤の如き熱分解物の発生が増え、炭化水素の無駄と処理済みガスの後工程が煩雑となり好ましくない。

【0043】分解塔内の温度は熱源を塔の内外いずれに置く場合も本発明方法でない単純熱分解(酸化分解を含む)に比べ数100℃の低温域においても処理可能である。

【 O O 4 4】単純熱分解の場合、例えばC2F6においては一例として1100~1200℃の温度域で除去率80~85%にしかならず、更に処理済みガス中にCF4の副生物が現れてくる。又、CF4の場合は、1400℃の温度領域においても除去率はせいぜい70%止まりであり、本発明が目的としている90%には程遠い。電熱ヒータを熱源にした場合、1400℃前後での長時間使用は技術的に困難であり、好ましくは1100℃以下の使用に止めるべきである。【 O O 4 5 】それに対して本発明によれば、従来のPFC単独又はO2共存下における分解反応より低温において除去が可能であり、例えばC2F6では850℃で十分であり、CF4では1000~1200℃で90%以上の除去率で処理が可能である。

【0046】分解塔に導入した炭化水素は、もしCVD

のクリーニング工程においてPFCの酸化用としてO2 又はO3を使用した場合、その残量があれば反応により 消滅し、更に付与された温度で熱分解し各種成分に分解 する。

【0047】例えばプロパンの場合、780℃で熱分解し、メタン、エタン、エチレン、プロピレン、水素、炭素の如き物質に変換する。その過程でC2F6、CF4の如きPFCも分解過程に関与し、F2又はHFの形でF成分が脱離される。

【0048】ガス分解塔で処理されたPFCのフッ素成分はF2又は/及びHFの形で排気される。この処理済ガスは後部水スクラバ(第2の水スクラバ)(3)を通すことにより水中にF成分を溶解せしめるか、CaO又はCaCO3の固形充填物を有する吸着塔に導きCaF2の形で吸着除去される。

【0049】上記いずれかの方法でF成分を無くしたガラス体は、処理済ガス燃焼塔(4)に送られる。ここで空気導入管(9)を通って送られてきた外部空気と混合され、可燃成分が燃焼され最終的にCO2. H2Oに戻した後に大気放出ガス放出管(8)を通して大気放出される。図中において(7)は吸引ファンである。

【0050】尚、処理済ガス燃焼塔(4)と後部水スクラバ(3)の位置を逆転させて、ガス分解塔で処理されたガスを処理済ガス燃焼塔(4)で燃焼してから後部水スクラバ(3)を通して冷却して大気放出するようにしても良い。すなわち、処理済ガス燃焼塔(4)と後部水スクラバ(3)は直列に配されていれば、いずれが先でも良い。

【0051】 [実施例1] 本実施例は、第1の水スクラバ、ガス分解塔、第2の水スクラバ、燃焼塔の順に処理する場合の実施例である。

【0052】CF4が1%、N2が99%の混合ガス30リットル/minを前部水スクラバ(第1の水スクラバ)を経由させ水洗してからガス分解塔に通した。このガス分解塔は内壁をアルミナ質キャスタブル耐火材で被覆し、その内部に棒状の電気ヒータ(アルミナ質保護管に封入)15本を立てて懸垂状態で保持した構造になっている。

【0053】ガス分解塔に還元性雰囲気形成剤として90%プロパン、10% n-ブタンの混合ガスを0.3リットル/minで供給した。ヒータ表面温度は、1100℃に保持した。キャビネット外部に設けたファンにより吸引し、系内部を負圧に保った状態で後部水スクラバ(第2の水スクラバ)を通して処理後副生したF2及びHFを水に吸収溶解させた。この場合の使用水量は10リットル/minとした。

【0054】次いで、第2の水スクラバで洗浄後のガスを内部温度が500℃に保たれた燃焼塔に導き、外部から導いた空気と共存下で酸化燃焼せしめた。処理済みガス中のCF4濃度を測定したところ、50ppmであり、CF4の除去率は99.5%であった。

【0055】 [比較例1] 実施例1と同じCF4組成の

ガスを実施例1と同じ除去装置に30リットル/minの風量で供給した。そして、ヒータ表面温度を1100℃に保ち、還元性雰囲気形成剤としての炭化水素ガス等は全く供給せず、処理後のガス中CF4の濃度を測定したところ9100ppmであった。すなわち、「除去率は僅か9%に止まった。

【 O O 5 6 】更に上記条件下ヒータ表面温度を瞬間的に 1450℃まで上昇せしめて処理後のガス濃度を測定したと ころ、3200ppmであり、除去率は68%となった。

【0058】以上の結果より、本発明は比較例より350 ℃も温度を下げた状態であるにもかかわらず、殆ど完全 にPFCの除去ができることがわかる。このように300 ~400℃も低い温度で目的が達成できるので、エネルギ ーコストを低くすることができ、装置の耐熱性等の観点 から材料選択の範囲も広くなる。

【0059】 [実施例2] 本実施例も、第1の水スクラバ、ガス分解塔、第2の水スクラバ、燃焼塔の順に処理する場合の実施例であるが、実施例1とは処理対象のPFCと、使用する還元性雰囲気形成剤が異なる。

【OO6O】 C_2F_6 が 2%, N_2 が97.9%, 酸素0.1%よりなる混合ガス100リットル \angle minを前部スクラバを経由させた後にガス分解塔に供給した。

【0061】このガス分解塔はSUS316Lで構成され、その内壁をアルミナ質キャスタブル耐火材で覆い、塔の外周に電熱ヒーター線を巻き付け、外部より加熱する構造になっている。

【0062】このガス分解塔の内部に還元性雰囲気形成剤としてメタン88%、エタン6%、プロパン4%、ブタン2%よりなる都市ガス(13A)を4リットル/min供給した。ガス分解塔の内部空間温度は850℃に保つようにした。処理済みガスは後部水スクラバ(供給水15リットル/min)で洗浄後、外部からの空気が供給された600℃に保たれた燃焼塔に通して排気した。

【0063】尚、本条件下では後部水スクラバにて煤 (微粉状炭素)が水中に浮遊し、霧状の煤が燃焼塔に移 行して除去された。

【0064】大気放出ガス中のC2F6濃度を測定したところ400ppmであり、除去率は98%となった。尚、処理ガス中にはCF4の存在は認められなかった。

【0065】 [実施例3] 上記実施例2の条件において 後部水スクラバの代わりに大豆大で粒状のCaOを充填 した吸着塔に備えた装置を用い、ガス分解塔で処理した ガスをこの吸着塔に通過させた。外部ファンで吸引した 条件下、排出ガス中には酸性成分は全く認められなかっ た

【0066】 [比較例2] 都市ガスを供給しない以外は

実施例2と同一条件下でPFCの排ガスを処理した。大 気放出ガス中のC2F6の濃度を測定したところ1.76%残 存した。すなわち、除去率は12%であった。又、処理 ガス中にはCF4が新たに副生していた。それ故、PF Cの除去率は先述の12%よりも更に悪くなる。

【0067】上記条件下において塔内空間温度を1150℃に保つ以外は同一条件としてC2F6の除去を行ったところ、排ガス中のC2F6濃度は4000ppmを示し、除去率は80%であった。又、CF4成分の副生も確認された。

【OO68】 [実施例4] 本実施例は装置の変形例であり、図2は本実施例の装置の概要を示した図であり、図中(A)は平面図、(B)は正面図である。

【0069】同図中において、(11)はガス分解燃焼塔であり、ガス分解塔としての役割を有するガス分解室(12)と燃焼塔としての役割を有する燃焼室(14)とが耐熱性を有する隔壁(13)を介して隣接して一体に設けられている。すなわち、本実施例の装置においては、ガス分解燃焼塔(11)はガス分解塔と燃焼塔とが隔壁を介して一体に形成されたものであると考えることができる。(このことは後述する実施例5も同様である。)隔壁(13)はセラミック質材料よりなり、例えばカオウール製ブランケット等を使用することができる。

【 O O 7 O 】ガス分解燃焼塔(11)の周囲はセラミック系 内張断熱層(15)が配されている。(16)はヒーター、(17) は炭化水素ガス導入管、(18)は空気導入管である。

【0071】前部水スクラバ(1)を経由してガス分解室(12)に導入された被処理ガスは、ガス分解室(12)で還元雰囲気下分解処理され、熱エネルギーを保有したままで隔壁(13)上部の隙間から隣接する燃焼室(14)に流入し、酸化雰囲気下で燃焼処理され、その後下流に設けられた水スクラバ(3)で冷却、洗浄後大気放出される。

【0072】ガス分解室(12)と燃焼室(14)とは隔壁(13)を隔てて隣接しており、しかも両者間には水スクラバが存在せず一旦冷却されることがないので、エネルギー消費を低減することができる。

【 O O 7 3 】このような装置構成とすると、図 1 に示した標準型の装置のようにガス分解部塔(2)と燃焼塔(4)とを個別に設けた場合よりも、装置全体をコンパクトにすることができ、設置床面積を縮小することができる。

【0074】又、ガス分解燃焼塔(11)の直下に水槽を設ける必要がなく、真下から横にずらした位置に設置可能であるので、上部の高熱部からの輻射熱が水槽の水を暖めることによる熱エネルギーの浪費も省くことができる。

【0075】更に、空気導入管(18)を通して燃焼室(14)に導入された外部空気は燃焼室(14)内を下方に移動する間に隔壁(13)を介してガス分解室(12)からの熱エネルギーを受けて加熱されるので、より一層の使用エネルギーの低減を図ることができる。

【0076】次に本実施例と、図1に示した装置のよう

にガス分解部塔(2)と燃焼塔(4)とを個別に設け、ガス分解部塔(2)と燃焼塔(4)との間に水スクラバを配した独立タイプのものについて除去率や使用エネルギーについて比較した。

【 O O 7 7 】まず独立タイプにおいて、C F 4が1.5%、N 2が98.5%の混合ガス 6 O リットル/minを分解塔(2)に通し、これに還元性雰囲気形成剤として90%プロパン、1 0% n ーブタンの混合ガスを0.6リットル/min供給し、ヒーター温度1300℃に保持した。

【0078】燃焼塔(4)から排出されるガスを分析したところ、500ppmになっており、CF4の除去率は96.7%であった。又、定常状態における電力消費量は7kW/hであった。

【 O O 7 9 】 この分解塔(2)内容積は2 4 リットルであり、処理ガス流量は60.6 リットル/mim=3636 リットル/hrであるので、S V (space velocity) =3636/24=151.5hr-1 となる。

【0080】一方、本実施例の装置に対しても上記と同じガス組成及びヒーター温度を保持せしめ、CF4の除去を行ったところ、処理済みガス中のCF4濃度は400ppmとなり、その除去率は97.3%であった。

【0081】定常状態における電力消費量は3.5kW/hであり、独立タイプの約1/2のエネルギー消費に止まった。

【0082】尚、本実施例のガス分解室(12)の内容積は21リットルであり、処理ガス流量は60.6リットル/mim=3636リットル/hrであるので、SV=3636/21=173.1hr-1 となる。

【0083】すなわち、本実施例の装置は、SVが若干大きいにもかかわらず、ほとんど独立タイプと同程度の除去率を得られ、且つ、消費エネルギーを1/2に迄低減させることができることがわかる。

【0084】 [実施例5] 本実施例は電熱ヒータで使用 しうる温度下において、PFCガスの除去率を向上さ せ、熱エネルギー効率を更に向上させた装置に関するも のである。

【0085】PFCガスの除去率を向上させるためには 被処理ガスに十分なエネルギーを伝えることと、そのた めの時間を十分確保できる設備構造とすることが必要で ある。

【0086】そこで、本実施例では電熱ヒータを水平に配置する共に、熱分散及び熱遮蔽を十分に行わしめ、更にガスの流れに撹拌効果を与えるために電熱ヒータの下方位置に火格子のように耐熱棒を複数本水平に設置している。

【 O O 8 7 】図3は本実施例の装置の概要を示した図である。(30)はPFC含有被処理ガス導入管、(20)は水槽、(31)は第1の水スクラバ、(21)はガス分解燃焼塔、(32)は第2の水スクラバ、(33)は大気放出ガス放出管である。ガス分解燃焼塔(21)は第1の水スクラバ(31)及び

第2の水スクラバ(32)の上方に配されている。

【〇〇88】図4はガス分解燃焼塔(21)の側断面図、図5はガス分解燃焼塔(21)の平面図である。ガス分解燃焼塔(21)内は耐熱性を有する隔壁(23)によりガス分解塔としての役割を有するガス分解室(22)と燃焼塔としての役割を有する燃焼室(24)とに区画されているが、隔壁(23)の上端部には隙間があり、ガス分解室(22)と燃焼室(24)とはこの隙間を介して連通している。したがって、ガス分解室(22)で還元雰囲気下分解処理されたガスは隔壁(23)上部の隙間から燃焼室(24)に流入することができる。

【0089】実施例4と同様にガス分解室(22)と燃焼室(24)とは隔壁(23)を隔てて隣接しており、しかも両者間には水スクラバが存在せず一旦冷却されることがないので、エネルギー消費を低減することができる。

【0090】隔壁(23)はセラミック質材料よりなり、例えばカオウール製ブランケット等を使用することができる。ガス分解燃焼塔(21)は熱エネルギーの損失を少なくするためにセラミック製内張断熱層(25)が形成されている。(27)は還元性雰囲気形成剤導入管、(28)は空気導入管である。

【0091】(26)は棒状の電熱ヒータであり、ガス分解燃焼塔(21)及びその内部の隔壁(23)を貫通するように水平方向に設置されている。電熱ヒータ(26)を水平に設置したのは、立てて(懸垂させて)配置した場合にはヒータ温度に偏りが出やすいからである。

【0092】すなわち、ヒータ上部は設定温度に達していても、ガス分解室(22)内の雰囲気は気流の影響で上方がより熱くなるので、ヒータ中央部以下の下部層においては分解に要する十分な温度を保持するのが困難である。一方、下部層が設定温度以上となるように制御するとヒータ上部は過熱状態になりやすく、エネルギー効率が悪くなると共にヒータの発熱体が溶断しやすくなる等の問題を生じやすくなる。

【0093】この点、電熱ヒータ(26)を水平に設置すると、電熱ヒータ(26)の長さ方向に均一な温度分布を保持することができ、PFCガス熱分解のために必要な温度雰囲気を無理なく形成することができる。

【0094】又、除去装置をクリーンルーム内に設置する場合には、クリーンルームの天井と除去装置と間に十分なスペースが確保できないことが多く、故障によるヒータ交換の際に電熱ヒータが立てて懸垂状態で設置されていると作業が容易ではないが、本実施例のようにヒータが水平に設置されていると電熱ヒータ(26)は横方向へ取り出しされるので作業が極めて容易になるという効果もある。

【0095】電熱ヒータの使用本数は6~12本程度が 好適であり、2~4段に等間隔配置するが、ガスが直進 しにくいように各段における水平方向の設置位置をずら すようにしている。本実施例では実用上の使いやすさを 考慮して各列3本の3段の計9本とした。ここで用いた 電熱ヒータ (26) は外径40 φ の99.5% α - A I 2O3製保護 管 (26b) にS i C製発熱体 (26a) を挿入したものを用いた。

【0096】(29)は最下段の電熱ヒータ(26)より100mm 下方において水平方向に複数本設置された耐熱棒であり、隔壁(23)を貫通するように水平方向に設置されている。本実施例では電熱ヒータ(26)と耐熱棒(29)は平行になるように(長手方向が同一となるように)配したが、直交する方向となるように配してもよい。

【 O O 9 7 】耐熱棒(29)は1300℃以上の耐熱性とF2と H F ガスに耐食性を有することが好ましく、セラミック 製の棒材等を利用することができるが、特にA I 2O3を 主成分とした断面円形の棒状体が好適である。耐熱棒(2 9)は中実(ムク)でも中空(パイプ状)でも良く、本実 施例では10mm の 099.5% α − A I 2O3製パイプを用い、 5 段構成で計48本使用したが、管径や使用本数はこれに 限定されるものではなく、適宜定めればよい。配置はヒ ータ(26)と同様にガスが直進しにくいように各段における水平方向の設置位置をずらすようにしている。

【0098】耐熱棒(29)は炉構造における火格子と同様の効果を有し、上部のヒータからの熱を受けて、熱エネルギーがガス分解燃焼塔(21)の下方に散逸するのを防ぐと共に、PFC含有ガス体及び還元性雰囲気形成体導入管(27)から導入される還元性雰囲気形成体を予備加熱する。

【0099】又、複数本の耐熱棒(29)の隙間を通過する間、PFC含有ガス体と還元性雰囲気形成体は耐熱棒(29)により生じる乱流により混合される。

【O100】更に、耐熱棒(29)により流速が低下するので、ガス分解燃焼塔(21)内での滞留時間を十分に確保することができ、除去率を向上させることができる。

【0101】尚、電熱ヒータ(26)はガス分解燃焼塔(21)及びその内部の隔壁(23)を貫通するように設置され、耐熱棒(29)も隔壁(23)を貫通するように設置されるが、これらの貫通箇所には耐熱性と耐食性を有するセラミックファイバーを主成分とするシーリング剤が塗布されガスの漏洩が防止されている。

【0102】本実施例の装置では各部の温度は、

ヒータ表面:1200~1350℃

ガス分解室空間及び燃焼室空間:1200~1300℃ ガス分解室の下部(ヒータより下方、耐熱棒より上 方):800℃

ガス分解室の最下部(耐熱棒下方の被処理ガス導入 部):200~300℃

燃焼室の下部(ヒータより下方、耐熱棒より上方):12 00℃

燃焼室の最下部(耐熱棒下方の処理ガス排出部):800 ℃

第2の水スクラバー通過直後:200℃

であった。この結果から、耐熱棒(29)により熱エネルギ

一の下方への散逸が有効に防止されていることがわかる。

【0103】次に、本実施例の装置を使用して実際に除去を行った。

【O 1 O 4】 C F 4が 1 %、 N 2が 9 9 % の混合ガス 140 リットル/mimを第 1 の水スクラバ (31) を経由させて上 方に位置するガス分解室 (22) に導入した。

【0105】又、ガス分解室(22)には第1のスクラバー(31)の上方に接続された還元性雰囲気形成剤導入管(27)より還元性雰囲気形成剤としてプロパンを1.4リットル/mim導入し、CF4との共存下において熱分解に供した

【0106】ガス分解室(22)で熱分解されたガスは隔壁(23)上部の隙間から燃焼室(24)に移動し、空気導入管(28)から導入される外部空気と共に燃焼室(24)内で燃焼して可燃性成分を燃焼除去され、燃焼室(24)の下方に位置する第2の水スクラバ(32)で冷却、洗浄後大気放出される。

【0107】第2の水スクラバ(32)から排気されたガス中のCF4 濃度を測定したところ、50ppmであった。すなわち、CF4の除去率は99.5%であった。又、以上の除去に使用した電力使用量は9kW/hであった。

【0108】次に還元性雰囲気形成剤としてプロパンの代わりにNH3ガス3.6リットル/mimを使用する以外は同一条件でCF4の除去を行った。その結果、処理済みガス中のCF4濃度は60ppmであり、除去率は99.4%となった。

【0109】 [比較例3] 比較のために電熱ヒータ9本を立てて懸垂状態に設置し、耐熱棒を全く使用しない以外は実施例5と同様の装置でCF4の除去を行った。

【 O 1 1 O 】処理ガス量は120リットル/mimに減量し、同一温度下でプロパン1.2リットル/mimを用いて処理したところ、処理済みガス中のCF4濃度は2.500ppmであり、除去率は75%であった。

【0111】又、このときの電力消費量は15kW/hであり、実施例5の装置を用いた場合の1.7倍に達した。このことからも、実施例5の除去装置は除去率が高く、低エネルギーコストであることがわかる。

[0112]

【発明の効果】以上述べたように本発明により低温でPFC成分を高い除去率で分解除去することが可能な除去方法及び除去装置を提供することができた。したがって、除去が困難なPFCガスを低いエネルギーコストで除去することができる。又、熱ロスが極力小さくなるような装置構成とすれば、更に低いエネルギーコストで除去することができる。

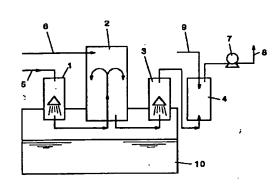
【図面の簡単な説明】

- 【図1】本発明の除去装置の概要を示した図。
- 【図2】 実施例4の除去装置の概要を示した図。
- 【図3】 実施例5の除去装置の概要を示した図。
- 【図4】実施例5のガス分解燃焼塔の側断面図。
- 【図5】実施例5のガス分解燃焼塔の平面図。

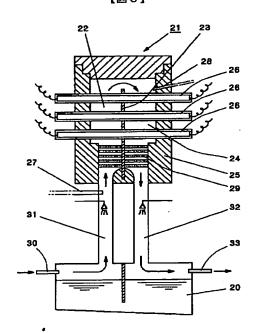
【符号の説明】

- (1) 前部水スクラバ (第1の水スクラバ)
- (2) PFC除去分解塔
- (3) 後部水スクラバ (第2の水スクラバ)
- (4) 処理済ガス燃焼塔
- (5) PFC含有被処理ガス導入管
- (6) 還元性雰囲気形成剤導入管
- (7) 吸引ファン
- (8) 大気放出ガス放出管
- (9) 空気導入管
- (10) 水槽
- (11) ガス分解燃焼塔
- (12) ガス分解室
- (13) 隔壁
- (14) 燃焼室
- (15) セラミック系内張断熱層
- (16) ヒーター
- (17) 炭化水素ガス導入管
- (18) 空気導入管
- (21) ガス分解燃焼塔
- (22) ガス分解室
- (23) 隔壁
- (24) 燃焼室
- (26) 電熱ヒータ
- (29) 耐熱棒

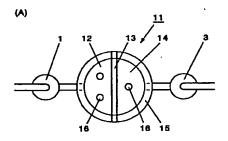


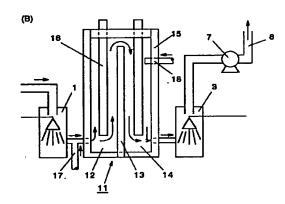


[図3]



[図2]





[図4]

